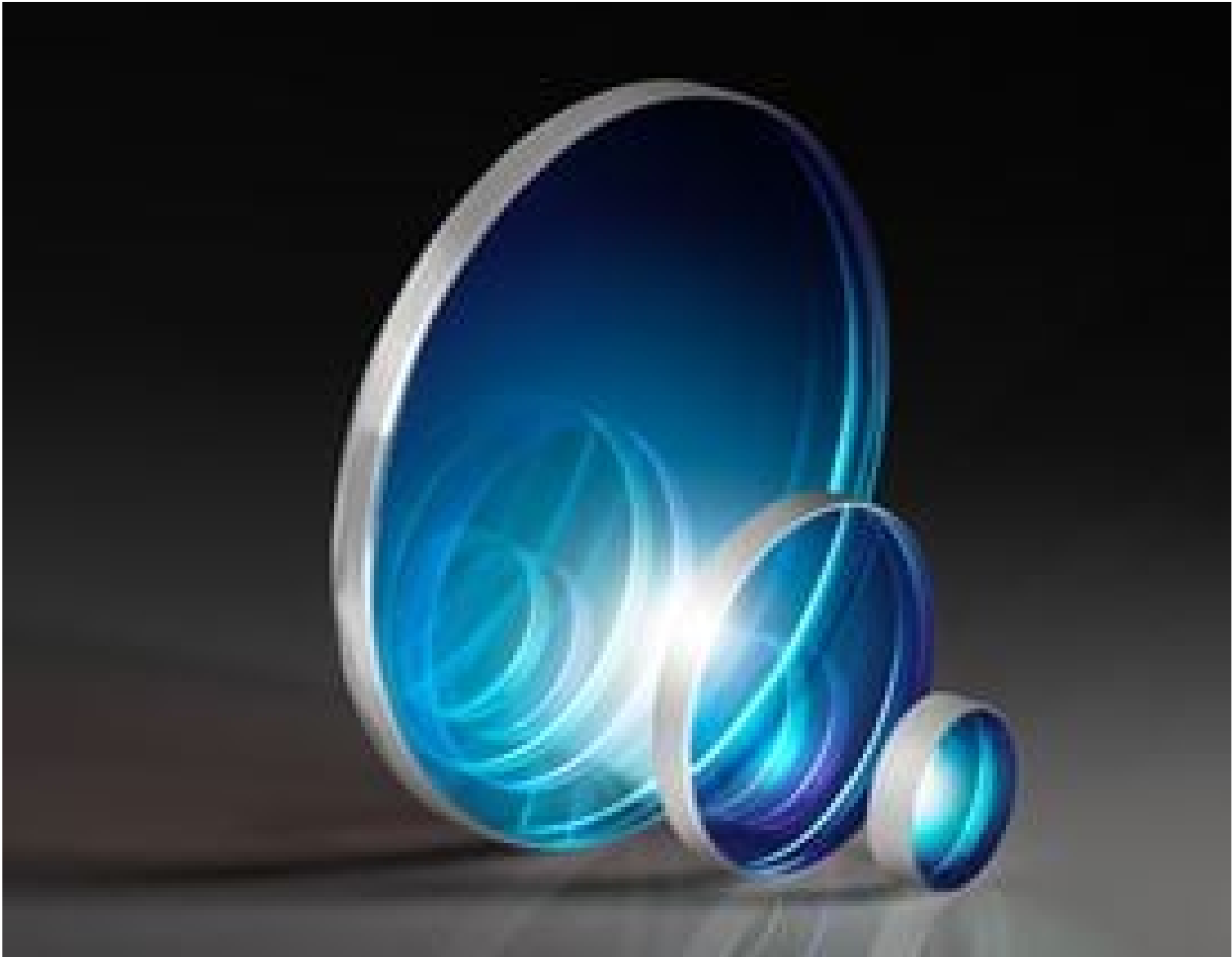


Dichroitischer Spiegel für Yb-dotierte Laser, geringe GDD, 940/1030 nm, 25 mm Durchmesser



Yb-Doped Dichroic Mirrors

Produkt **#28-972** **5 In Stock**

-

1

+

€585^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€585,00 stückpreis
Stk. 6-25	€497,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

High Power Dichroic Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.00 +0.0/-0.10	Durchmesser (mm):
22.50	Freie Apertur CA (mm):
3.00 ±0.20	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:
30' ±10'	Keilwinkel (arcmin):
Optische Eigenschaften	
940nm/1030nm	Designwellenlänge DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
0 - 5	Einfallswinkel (°):
S1: HR 1030nm ± 5nm, AR 940 ± 5nm S2: AR 940nm & 1030nm ± 5nm	Beschichtung:
S1: R _p & R _s >99.5% @ 1030nm; T _p & T _s >98% @ 940nm @ 0 – 5° AOI S2: T _p & T _s >98% @ 940nm & 1030nm	Beschichtungsspezifikation:
1.458	Brechungsindex (n _d):
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
10-5	Oberflächenqualität:
> 20 J/cm ² @ 10ns pulses @5 kHz PRF 1MW/cm ² CW	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Hohe Reflexion bei 1030 nm und hohe Transmission bei 940 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) <±100 fs²
- Dichroitische Spiegel entwickelt für Ytterbium-Laser (Yb)

Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser erreichen eine hohe Reflexion von 99,5% bei 1030 nm und eine Transmission von 98% bei 940 nm bei einem großen Akzeptanzwinkel von 0-5°. Die keilförmigen Substrate minimieren Rückreflexionen sogar bei 0° Einfallswinkel, sodass die Spiegel unerwünschtes Feedback in Lasersystemen auslöschen. Die Spiegel sind mit einem Durchmesser von 12,5 mm, 25 mm oder 50 mm und 3 mm Dicke erhältlich. Die Spiegel sind ideal für präzise Materialbearbeitungen geeignet und wurden für Anwendungen mit hoher Leistung und Nanosekundenpulsen entwickelt. Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser bieten außerdem eine geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von <±100 fs² zwischen 1030 nm und 1080 nm, was sie ideal für ultrakurze Pulse und nichtlineare Anwendungen wie die Multiphotonenmikroskopie macht.